

特 許 協 力 条 約

PCT

REC'D 21 APR 2005

WIPO

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条)

[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 KO5320PCT	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/003810	国際出願日 (日.月.年) 19.03.2004	優先日 (日.月.年) 20.03.2003
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. C03C15/00, C03B20/00, C03C3/06		
出願人 (氏名又は名称) 独立行政法人科学技術振興機構		

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。  
法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。

a ☒ 附属書類は全部で 2 ページである。

☒ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙 (PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)

☐ 第I欄4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙

b ☐ 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。  
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第802号参照)

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

☒ 第I欄 国際予備審査報告の基礎

☐ 第II欄 優先権

☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成

☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如

☒ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明

☒ 第VI欄 ある種の引用文献

☐ 第VII欄 国際出願の不備

☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 01.11.2004	国際予備審査報告を作成した日 01.04.2005	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 永田 史泰	4 T 3342
電話番号 03-3581-1101 内線 3463		

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (2004年1月)

## 第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

- ☐ この報告は、\_\_\_\_\_ 語による翻訳文を基礎とした。  
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

- ☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査  
☐ PCT規則12.4にいう国際公開  
☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に回答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書

第 1-20 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☒ 請求の範囲

第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
第 \_\_\_\_\_ 項\*、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
第 1-7 \_\_\_\_\_ 項\*、 01.11.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☒ 図面

第 1-4 \_\_\_\_\_ ~~ページ~~/図、 出願時に提出されたもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☒ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☒ 請求の範囲 第 8 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

\* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-7	有 無
	請求の範囲		
進歩性 (IS)	請求の範囲	1-7	有 無
	請求の範囲		
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-7	有 無
	請求の範囲		

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP 59-102832 A (株式会社諏訪精工舎) 1984. 06. 14  
 文献2: JP 57-188432 A (株式会社保谷硝子) 1982. 11. 19  
 文献3: JP 57-205337 A (株式会社保谷硝子) 1982. 12. 16  
 文献4: JP 06-199538 A (パテントートロイハントーゲゼルシャフト  
 ユア エレクトリツシエ グリユーランペン ミット ベシユレンクテル ハフ  
 ツング)  
 1994. 07. 19

請求の範囲 1-7

新規性・進歩性あり

請求の範囲 1-7に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1-4の何れにも開示されておらず、新規性を有する。特に、ホウケイ酸塩ガラスに熱処理を施して分相させる分相工程と、酸処理工程と、焼結工程とを含む高ケイ酸ガラスの製造方法において、原料となるホウケイ酸塩ガラスに、マンガン、セリウム、クロム、コバルト、銅のうち何れかの元素を含んでなるホウケイ酸塩ガラスを用いる点は、開示されていない。

なお、第6欄記載のJP 2003-313050 Aには、Cu<sub>2</sub>Oを0.5wt%含んでなるホウケイ酸塩ガラスに熱処理を施して分相させる工程と、酸処理工程と、焼結工程を含む高ケイ酸ガラスの製造方法、及び当該製造方法によって表面に高ケイ酸層を形成させたガラスが記載されている（特に【0062】～【0066】）。

第VI欄 ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書 (PCT規則70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日. 月. 年)	優先日 (有効な優先権の主張) (日. 月. 年)
JP 2003-313050 A 「E, X」	2003. 11. 06	2002. 04. 17	

2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付 (日. 月. 年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日. 月. 年)

21

請 求 の 範 囲

1. (補正後) マンガン、セリウム、クロム、コバルト、銅のうち何れ  
かの元素を含んでなるホウケイ酸塩ガラスに熱処理を施して分相する工  
程と、

分相された上記ホウケイ酸塩ガラスに酸処理を施して金属を溶出する  
酸処理工程と、

酸処理された上記ホウケイ酸塩ガラスを焼結する焼結工程とを含むこ  
とを特徴とする高ケイ酸ガラスの製造方法。

2. (補正後) 上記ホウケイ酸塩ガラスは、上記元素の酸化物を0.1  
重量%以上2.0重量%以下の割合で含むことを特徴とする請求の範囲  
1に記載の高ケイ酸ガラスの製造方法。

3. (補正後) 上記ホウケイ酸塩ガラスは、原料を加熱して熔融する溶  
融工程を2回実施して作製されたものであることを特徴とする請求の範  
囲1または2に記載の高ケイ酸ガラスの製造方法。

4. (補正後) 上記ホウケイ酸塩ガラスに含まれるホウ酸は、2回実施  
される上記熔融工程のうちの第2回目の工程において添加されることを  
特徴とする請求の範囲3に記載の高ケイ酸ガラスの製造方法。

5. (補正後) 上記ホウケイ酸塩ガラスがセリウムまたはクロムを含む  
場合に、

22

上記酸処理工程と上記焼結工程との間で、上記ホウケイ酸塩ガラスに  
対して、熱処理と酸処理とが繰り返し行われ、さらに、エチレンジアミ  
ン四酢酸を含有する酸を用いてさらなる酸処理が施されることを特徴と  
する請求の範囲 1 ないし 4 の何れか 1 項に記載の高ケイ酸ガラスの製造  
方法。

6. (補正後) 請求の範囲 1 ないし 5 の何れか 1 項に記載の高ケイ酸ガ  
ラスの製造方法により製造されることを特徴とする高ケイ酸ガラス。

7. (補正後) ホウ素を 10 ppm 以上含み、厚さ 1 mm とした場合に  
、波長 200 nm の光を 30 % 以上透過することを特徴とする請求の範  
囲第 6 項に記載の高ケイ酸ガラス。

8. (削除)